# 静态随机存储器总剂量辐射损伤的 在线与离线测试方法

丛忠超<sup>1)2)</sup> 余学峰<sup>1)†</sup> 崔江维<sup>1)</sup> 郑齐文<sup>1)2)</sup> 郭旗<sup>1)</sup> 孙静<sup>1)</sup> 汪波<sup>1)2)</sup> 马武英<sup>1)2)</sup> 玛丽娅<sup>1)2)</sup> 周航<sup>1)2)</sup>

 1)(新疆理化技术研究所,中国科学院特殊环境功能材料与器件重点实验室,新疆电子信息材料与器件重点实验室, 乌鲁木齐 830011)
 2)(中国科学院大学,北京 100049)

(2013年12月17日收到;2014年1月6日收到修改稿)

以静态随机存储器为研究对象,对其在线和离线测试下的总剂量辐射损伤规律进行了研究. 探寻了两种 测试条件下总剂量损伤的差异并对造成差异的物理机制进行了分析和讨论. 研究结果表明:由于静态随机存 储器存在多种总剂量失效模式,相对于在线测试只能覆盖存储单元固定错误的一种失效模式,离线测试可覆 盖多种功能失效模式;由于信号完整性对测试频率的限制,使得在线测试得到的动态功耗电流值要明显小于 离线测试得到的动态功耗电流值;由于"印记效应"的存在,在线测试静态功耗电流小于离线测试中器件存储 与辐照相反数据时的静态功耗电流值;在线无法测量的一些电参数,有可能先于在线可测参数而失效. 这些 研究结果对于静态随机存储器在星用辐射环境下的总剂量辐射损伤规律的研究和实验评估具有重要意义.

关键词: 在线测试, 离线测试, 静态随机存储器, 功能测试 **PACS:** 61.80.Ed, 61.82.Fk, 85.30.Tv, 07.85.-m

**DOI:** 10.7498/aps.63.086101

### 1引言

静态随机存储器 (SRAM) 是数字处理、信息处 理、自动控制设备中的重要组成部件,被广泛应用 于航天器的控制系统中. 空间辐射环境中的带电粒 子 (如电子、质子与带电重粒子)和宇宙射线会改变 半导体材料及器件的电学特性<sup>[1-3]</sup>,从而对 SRAM 器件造成辐射损伤<sup>[4-7]</sup>,严重威胁着航天器工作的 可靠性和安全性. 因此,器件在空间应用前需要进 行地面模拟评估试验来确定是否满足抗辐射性能 要求.

自20世纪70年代初以来,国内外开展了大量有关SRAM总剂量辐射效应和评估方法的研究<sup>[8-14]</sup>,目前在辐照试验中通常采用两种方法对SRAM器件的总剂量辐射损伤进行测试,即离线测

试与在线测试.

离线测试是指利用大规模集成电路自动测试 设备 (ATE),在不同的累积剂量点对器件进行工 业标准的全参数测试,根据参数测试结果是否在器 件正常工作范围内来判定器件能否承受相应剂量 的总剂量辐照.离线测试可以准确全面地测试器件 的总剂量辐射损伤,但其存在测试参数多且测试方 法复杂的问题,测试程序开发及调试周期较长,所 以目前在SRAM器件的总剂量辐射评估试验中仍 多采用在线测试方法.

在线测试是指在器件辐照期间对器件进行功 能及电流参数的测试,实时监测器件的功能是否 正常以及电流参数是否在可承受范围内. SRAM 器件在线测试多在以现场可编程门阵列 (FPGA) 器件为核心的测试板上完成,该测试方法具有 开发成本低、开发周期短以及测试系统便于携带

<sup>†</sup>通讯作者. E-mail: yuxf@ms.xjb.ac.cn

<sup>© 2014</sup> 中国物理学会 Chinese Physical Society

的优点. 但是, 在线测试系统存在测试参数少的问题.

为了明确大规模 SRAM 器件辐射损伤不同测 试方法的优劣,特别是不同测试结果对 SRAM 器件 辐射损伤评估的全面性和可靠性的影响,本文对目 前常用的 SRAM 器件总剂量辐射损伤的两种试验 测试方法,即在线与离线测试方法进行了比较,对 产生测试结果差异的物理机理进行了研究,并对测 试方法、测试结果差异对最终辐射损伤评估的影响 进行了分析.研究结果对于进一步提高、保障应用 于空间等辐射环境的大规模 SRAM 器件的可靠性 具有十分重要的意义.

2 测试系统及辐照试验

### 2.1 离线测试系统

本次试验中,通过Adwantest 93000大规模 集成电路测试机台对SRAM器件进行离线测试. 在不同累积剂量点,对器件分别进行功能测试 和直流、交流参数测试,测试参数及测试方法如 表1所示.

表1 离线测试参数及测试方法

测试参数	测试方法	
功能测试 (Function)	进行覆盖不同功能失效模式测试图形的功能测试,	
	如 Solid, Checkerboard, March_6N, Galcol, Galrow	
输入漏电流 (ILI)	置输入端口电平为GND, Vdd,分别测试流经各端口的电流	
输出漏电流 (I <sub>LO</sub> )	在输出高阻态条件下,置输出端口电平为GND,	
	V <sub>dd</sub> ,分别测试流经各端口的电流	
输入低电平阈值 (VIL)	在功能测试下, 扫描输入低电平, 找到器件功能失	
	效、通过的临界点,该临界电压即为 $V_{\rm IL}$	
输入高电平阈值 (V <sub>IH</sub> )	在功能测试下, 扫描输入高电平, 找到器件功能失	
	效、通过的临界点,该临界电压即为 VIH	
输出低电平 (V <sub>OL</sub> )	在功能测试下,扫描输出低电平阈值,找到器件功	
	能失效、通过的临界点,该临界电压即为 $V_{OL}$	
输出高电平 (V <sub>OH</sub> )	在功能测试下,扫描输出高电平阈值,找到器件功能	
	失效、通过的临界点,该临界电压即为 $V_{OH}$	
静态功耗电流 $(I_standby)$	分别测试器件存储与辐照期间相同及相反数据时	
	的静态功耗电流	
动态功耗电流 ( $I_{\text{function}}$ )	测试器件处于读操作时流经器件的电流	
读数据延迟 ( $T_{read dely}$ )	在功能测试下,扫描读取数据位置,找到器件功能	
	失效、通过的临界点,该临界点与地址跳变沿的距离即 $T_{\text{read dely}}$	
写脉冲时间 ( $T_write plus width$ )	在功能测试下, 扫描 WE 端口跳变位置, 找到器件	
	功能失效、通过的临界点,该临界点与地址跳变沿	
	的距离即 <i>T</i> _write plus width	

### 2.2 在线测试系统

图1是在线测试系统的结构简图,它由计算 机、控制板、辐照板、数字万用表、电源组成.图中实 线表示信号路径,虚线表示电源路径,箭头表示信 号的流动方向.在线测试系统的测试参数及测试方 法如表2所示.

### 2.3 试验方法及样品信息

辐照试验在中国科学院新疆理化技术研究所 <sup>60</sup>Co-γ射线源上进行,辐照剂量率为 0.51 Gy(Si)/s. 辐照前,利用在线测试系统对S-RAM写入十六进制数"AA",即每个存储单元中存入8位二进制数"10101010". 辐照中,对器件进行 在线测试,并且在累积到一定剂量时,将器件取出

### 并进行离线测试.

试验样品采用互补金属氧化物半导体 (CMOS) 工艺SRAM, 样品信息如表3所示.

### 3 试验结果与讨论

#### 功能测试 3.1

在线测试中,器件K6R4008V1D至累积剂量 5000 Gy仍可以通过功能测试,未发现存储单元 发生翻转. 然而在离线测试中,该器件在累积 到4000 Gy时功能失效,无法通过功能测试图形 行简化奔跳 (Galrow)、列简化奔跳 (Galcol)、行进 (March 6N)、棋盘格 (Checkerboard) 的功能测试, 但可以通过固定数据 (Solid) 的测试, 如表4所示. 其中 Solid 测试图形即为对器件遍历地址写入读取 固定数据,该测试方法与在线测试中的功能测试方 法一致.



表 2	在线测试的测试参数及测试方法
12.4	化成例风的例风多级及例风力公

测试参数			测	测试方法		
功能测试 (Function)			辐	辐照期间反复读取器件存储数据,并记录出错存储单元数目、翻转方向及翻转地址		
静态功耗电流 ( $I_{\text{standby}}$ )			在	在两次读操作之间置器件于静态一定时间,测试流经器件的电流		
动态功耗电流 ( $I_{\text{function}}$ )				器件处于读操	作时,测试流经器件的电流	
	表3	试验样品信息	1		法只能覆盖存储单元固定错误一种失效模式,所以	
样品型号 制	一 在线测试中的功能测试方法存在高估器件抗器。					
IDT1V124SA	IDT (	).18 μm	6T	1 M	在离线测试中,我们对器件进行了覆盖多种失	
K6R4008V1D	三星 (	).18 μm	6T	4 M	效模式的不同测试图形的功能测试,在累积剂量	
表 4 三星 K6R4008V1D 在不同剂量点的功能测试的结果					4000 Gy 时,器件发生功能失效,但仍可以通过Sol- id测试图形的功能测试,表明该器件并未发生存储	
测试图形	辐照	前 2000	Gy	4000 Gy	单元固定错误. 在失效测试图形的测试中, 几乎所	
Galrow	通过	t آ	đ	失败	有存储单元都出现错误,如图2所示,在Checker-	
Galcol	通过	t آ	đ	失败	board 测试图形中失效存储单元一致表现为输出相	
March_6N	通过	t آ	过	失败	反数据. 问时, 测试结果表明, 通过降低测试频率可 以减小山供存储单云数日、加图2.65云、测试频率	
Checkerboard	通过	t آ	过	失败	以减少出销任储毕儿数日.如图3 加小, 测试频率 为50 MHz时 Checkerboard 中生效左键单元所占	
Solid	通过	<u>آ</u> ل ا	Ċ	通过	比列为99.9%; 而当测试频率降为10 MHz时, 失效	
<b>左</b> 42週1月日	17日)3	与取用点米	· 년 가	42300半子:>>	存储单元比列下降为1%;进一步降低测试频率为	

在线测试中写入读取固定数据功能测试方法 覆盖的SRAM 功能失效模式为存储单元固定错误, 即存储单元只能单一存储数据"0"或"1".事实上, SRAM器件的功能失效可分为存储单元失效和外 围电路失效,且表现为多种失效模式,如存储单元 固定错误、存储单元转移错误、存储单元耦合错误、 译码器错误等,而写入读取固定数据的功能测试方

0.1 MHz时,器件则可通过Checkerboard测试.以

上试验结果进一步表明器件未出现具有永久失效 特点的存储单元固定错误,而是表现为外围电路失 效,但由于SRAM器件电路结构复杂且商用器件无 法获知其内部电路结构及工艺信息,使得我们很难 由宏观电参数的测试结果来分析获得器件的具体 功能失效模式及功能失效机制.



图 2 数据端口在棋盘格测试图形中的输出波形图

以上分析表明,由于SRAM器件复杂的电路 结构,使得其总剂量辐照功能失效模式同样表现出 复杂的形式,器件K6R4008V1D功能失效为外围 电路失效且写入读取固定数据的功能测试无法检 测出该功能失效,进而给器件的总剂量辐射测试的 功能测试方法提出了更高的要求.

### 3.2 功耗电流测试

图 4 为静态功耗电流随总剂量的变化关系.如 图所示,在线测试的静态功耗电流与离线测试中写 入数据"AA"时的静态功耗电流表现出同样的变化 趋势,且静态功耗电流值一致,但离线测试中写入 数据"55"时的静态功耗电流值大于在线测试的静 态功耗电流.

由图4可知,测试数据为AA时,在线测试与离 线测试所得到的静态功耗电流值相同.由于在线测 试静态功耗电流的方法是使器件在两次读取操作 间隔内,使器件处于一定时间的静态状态进行电流 测试,此时器件存储的数据为辐照期间器件存储的 数据,该测试条件与离线测试中写入与辐照相同数 据静态功耗电流的测试条件一致,所以两者得到相 同的试验结果.

SRAM 器件的静态功耗电流主要来源于存储 单元中晶体管的关态漏电流,总剂量辐射在氧化 物中产生的陷阱电荷改变晶体管的关断特性,进 而使得器件的静态功耗电流上升.图5是6T结构 SRAM存储单元的结构图,其中 $M_5$ 和 $M_6$ 为数据 传输晶体管,两端分别与位线和存储节点"Q"相 连.而 $M_1$ , $M_2$ , $M_3$ 和 $M_4$ 分别为下拉N型金属氧 化物半导体 (NMOS)晶体管和上拉P型金属氧化 物半导体 (PMOS)晶体管,它们组成了最基本的



图 3 功能测试图形棋盘格在不同测试频率下的位图 (a) 50 MHz; (b) 10 MHz



图 4 静态功耗电流随总剂量的变化曲线 (AA 与 55 分 别表示写入与辐照相同和相反的数据)

数据存储单元.我们假设该存储单元在辐照过程中 存入数据"1",即存储节点Q的电位为高、Q电位为 低,这时M<sub>1</sub>和M<sub>4</sub>晶体管导通,而晶体管M<sub>2</sub>和M<sub>3</sub> 截止.当存储单元存储与辐照相同数据"1"时,总 剂量辐照引起的静态功耗电流上升来源于漏电路 径2,即晶体管M<sub>2</sub>的关态漏电流.然而,当存储单 元存储与辐照相反数据"0"时,静态功耗电流上升 来源于漏电途径1,即晶体管 M<sub>1</sub> 的关态漏电流<sup>[15]</sup>. 辐照期间处于开启状态的 N 型金属氧化层-半导体 场效晶体管 (NMOSFET) 产生的关态漏电流大于 处于关闭状态的 NMOSFET,辐照期间晶体管 M<sub>1</sub> 处于开启状态, M<sub>2</sub> 处于关闭状态,所以 M<sub>1</sub> 中辐照 引起的关态漏电流大于 M<sub>2</sub>,因此器件存储与辐照 相反数据时的静态功耗电流要大于存储相同数据 时的静态功耗电流,这就是所谓的"印记效应"的物 理机理.

以上试验数据表明,在线测试中以器件中存储 与辐照相同数据的静态功耗电流值来判断器件是 否正常工作,存在高估器件抗总剂量辐照能力的 风险.

图 6 为器件动态功耗电流随总剂量的变化关 系,在线测试与离线测试得到的动态功耗电流随总 剂量有同样的变化趋势,但离线测试得到的电流值 要大于在线测试所得到的结果,这可能与器件的工 作频率有关.



图6 在线测试与离线测试得到的动态功耗电流随总剂 量的变化关系

(1)式为存储阵列为m列n行的SRAM功耗电流 IDD 统一近似表达式,它由三部分构成,存储单

元阵列电流 ( $I_{array}$ )、译码器电流 ( $I_{decode}$ ) 和外围 电路电流 ( $I_{periphery}$ ). 其中 $i_{act}$  为工作中的存储单 元的等效电流,  $i_{hld}$  为存储单元处于数据保存状态 的漏电流,  $C_{DE}$  为译码器输出节点电容,  $C_{PT}$  为逻 辑电路和外围电路的总电容,  $V_{int}$  为内部电源电压,  $I_{DCP}$  为外围电路的静态电流, f 为工作频率<sup>[16]</sup>.

$$I_{\rm DD} = I_{\rm array} + I_{\rm decode} + I_{\rm periphery}$$
  
=  $[mi_{\rm act} + m(n-1)i_{\rm hld}]$   
+  $[(n+m)C_{\rm DE}V_{\rm int}f]$   
+  $[C_{\rm PT}V_{\rm int}f + I_{\rm DCP}].$  (1)

在线测试与离线测试中动态功耗电流的测试 都是在器件处于遍历地址读取与辐照相同数据时 进行的,但是由于长线传输带来的信号完整性问 题,使得在线测试的测试频率为1 MHz,而离线测 试的测试频率为50 MHz.由(1)式可知,器件动态 功耗电流中的 *I*<sub>decode</sub> 及 *I*<sub>periphery</sub> 部分与器件的工 作频率直接相关.

综合以上分析,工作频率越大,动态功耗电流 就越大.由于在线测试系统工作频率的限制,测到 的动态功耗电流要小于离线测试系统得到的结果. 因此,我们认为以在线测试得到的动态功耗电流去 判断器件的功耗是否满足正常工作要求,会高估器 件的抗总剂量辐射能力.

### 3.3 其他参数

在线测试中,选取SRAM直流及交流参数中 的静态及动态功耗电流进行实时监测,利用功耗电 流随总剂量的变化来表征器件的总剂量辐照损伤 程度,并判定器件是否发生参数失效.总剂量辐射 对集成电路的损伤主要表现为增加器件的静态功 耗电流,器件的静态功耗电流随总剂量辐照剧烈增 长.如图7所示,器件K6R4008V1D的静态功耗电 流随累积剂量指数增长,在5000 Gy处,静态功耗 电流上升了180倍,而其他直流及交流参数同样受 总剂量辐照的影响发生变化,但改变幅度远小于静 态功耗电流.试验数据表明静态功耗电流受总剂量 影响最大,可以很好地表征器件的总剂量辐照损伤 程度.

如图8所示,器件IDT71V124直流参数输入 低电平阈值 (V<sub>IL</sub>)的变化幅度远小于静态功耗电 流 (*I*\_standby),但在累积剂量360 Gy 处,总剂量 辐照使 V<sub>IL</sub> 下降至 0.79 V, 小于器件手册中 0.8 V 的 要求, 发生参数失效, 而此时 *I*\_stanby 为 1.12 mA, 仍在器件手册的正常值范围内.

虽然静态功耗电流随总剂量变化最为剧烈,但 并不能说明在SRAM的总剂量辐照评估中可以只 对静态功耗电流这一直流参数进行测试,其他电参 数虽然随总剂量的变化幅度较小,但仍有先于静态 功耗电流参数失效的可能性.因此,在测试时间允 许的条件下,应该对SRAM进行更全面的参数测 试,以保证我们对SRAM的抗总剂量辐射能力的准 确认识.



图 7 器件 K6R4008V1D 直流及交流参数变化幅度与总 剂量的关系



图 8 器件 IDT71V124 输入低电平阈值及静态功耗电流 随总剂量的变化关系

4 结 论

本文对SRAM 总剂量辐射损伤的在线和离线 测试结果进行了对比试验,研究了二者的差异及产 生差异的物理机制.结果表明,由于SRAM 的总剂 量辐射损伤存在"印记效应",在离线测试时,写入 与辐照相反的数据所测到的静态功耗电流值大于 写入与辐照相同数据所测得的静态功耗电流值.离 线测试所得到的动态功耗电流值要明显大于在线 测试得到的结果.这是由于信号完整性对测试频率 的限制,导致在线测试得到的动态功耗电流值明显 小于 SRAM 正常工作频率下的动态功耗电流值.

在功能测试方面, 通过离线测试系统对 SRAM 进行多种测试图形的功能测试, 同时还通过在线测 试系统对 SRAM 的错误数进行实时监测.结果表 明, 早在在线测试检测到存储单元翻转之前, 离线 测试系统已经检测出部分功能失效.这说明在功能 测试方面, 离线测试系统相比于在线测试系统对器 件辐射损伤的测试更加全面.

通过离线测试系统对 SRAM 的其他电流参数 测试得到的结果表明, 虽然静态功耗电流随总剂量 变化最明显, 但是在静态功耗电流超出器件手册上 的参数指标之前, 输入低电平参数 V<sub>IL</sub> 就已经失效. 这说明在总剂量辐射环境下, 静态功耗电流并不是 SRAM 惟一的失效判据.

以上结论明确了在测试要求严格的情况下离 线测试的必要性,为SRAM的总剂量辐射损伤及可 靠性评估提供了有力的参考,为卫星及航天器控制 系统的正常运行提供了前提保障.

### 参考文献

- Li D M, Wang Z H, Huang P L Y, Gou Q J 2007 Chin. Phys. 16 3760
- [2] Gao B, Liu G, Wang L X, Han Z S, Song L M, Zhang Y F, Teng R, Wu H Z 2013 *Chin. Phys. B* 22 036103
- [3] Jin X M, Fan R Y, Chen W, Lin D S, Yang S C, Bai X Y, Liu Y, Guo X Q, Wang G Z 2010 *Chin. Phys. B* 19 066104
- [4] Gao B, Yu X F, Ren D Y, Li Y D, Cui J W, Li M S, Li M, Wang Y Y 2011 Acta Phys. Sin. 60 036106 (in Chinese) [高博, 余学峰, 任迪远, 李豫东, 崔江维, 李茂顺, 李明, 王义元 2011 物理学报 60 036106]
- [5] Schwank J R, Shaneyfelt M R, Fleetwood D M, Felix J A, Dodd P E, Paillet P, Cavrois V F 2008 *IEEE Trans. Nucl. Sci.* 55 1833
- [6] Doucin B, Poivey C, Carlotti C, Space M M, Salminen A, Ojasalo K, Ahonen R, Poirot P, Baudry L, Harboe Sorensen R 1997 *Radiation and its Effects on Components and Systems* Cannes, France September 15–19, 1997 p50
- [7] Schott J T, Zugich M H 1987 IEEE Trans. Nucl. Sci. 34 1403
- [8] Zheng Q W, Yu X F, Cui J W, Guo Q, Ren D Y, Cong Z C 2013 Acta Phys. Sin. 62 116101 (in Chinese) [郑齐 文, 余学峰, 崔江维, 郭旗, 任迪远, 丛忠超 2013 物理学报 62 116101]

- [9] He C H, Geng B, He B P, Yao Y J, Li Y H, Peng H L, Lin D S, Zhou H, Chen Y S 2004 Acta Phys. Sin. 53 199 (in Chinese) [贺朝会, 耿斌, 何宝平, 姚玉娟, 李永宏, 彭宏论, 林东生, 周辉, 陈雨生 2004 物理学报 53 199]
- [10] Li M, Yu X F, Xue Y G, Lu J, Cui J W, Gao B 2012
   Acta Phys. Sin. 61 106103 (in Chinese) [李明, 余学峰, 薛耀国, 卢建, 崔江维, 高博 2012 物理学报 61 106103]
- [11] Li M, Yu X F, Xu F Y, Li M S, Gao B, Cui J W, Zhou D, Xi S B, Wang F 2012 Atomic Energy Sci. Technology 46 507 (in Chinese) [李明, 余学峰, 许发月, 李茂顺, 高博, 崔江维, 周东, 席善斌, 王飞 2012 原子能科学技术 46 507]
- [12] Lelis A J, Murrill S R, Oldham T R, Robertson D N 1996 IEEE Trans. Nucl. Sci. 43 3103

- [13] Yao X Y, Hindman N, Clark L T, Holbert K E, Alexander D R, Shedd W M 2008 *IEEE Trans. Nucl. Sci.* 55 3280
- [14] Cui J W, Yu X F, Ren D Y, Lu J 2012 Acta Phys. Sin.
  61 026102 (in Chinese) [崔江维, 余学峰, 任迪远, 卢建 2012 物理学报 61 026102]
- [15] Yu X F, Ren D Y 1997 Nucl. Tech. 20 24 (in Chinese)
   [余学锋, 任迪远 1997 核技术 20 24]
- [16] Rabaey J M (translated by Zhou R D, et al.) 2004 Digital Integrated Circuits (Beijing: Publishing House of Electronics Industry) pp518–523 (in Chinese) [拉贝艾 J M 著 (周润德等译) 2004 数字集成电路 (北京: 电子工业出 版社) 第 518—523 页]

## Online and offline test method of total dose radiation damage on static random access memory

1) (Xinjiang Key Laboratory of Electronic Information Materials and Devices CAS Key Laboratory of Special Materials and

Devices, Xinjiang Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Urumqi 830011, China)

2) (University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

( Received 17 December 2013; revised manuscript received 6 January 2014 )

#### Abstract

In this paper, for the study of static random access memory (SRAM), the online-test and offline-test are carried out on the total dose radiation damages. The differences between the two kinds of test methods and physical mechanisms are investigated. The results show that SRAM present multiple failure mode, the online-test only includes one fixed failure mode and the offline-test includes multiple failure mode. Due to the restrictions on signal integrity at test frequency, the online dynamic current test value is significantly less than offline test value. Since the existence of imprinting effect, the online-test static current is significantly less than offline-test value when the device-stored data are opposite to irradiation data. The parameters that cannot be detected online, may lapse prior to the data that could be detected online. The results are significantly important for studying the total dose radiation effect and the experimental evaluation of SRAM under radiation environment.

Keywords: online-test, offline-test, static random access memory, functional test

**PACS:** 61.80.Ed, 61.82.Fk, 85.30.Tv, 07.85.-m

**DOI:** 10.7498/aps.63.086101

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail: yuxf@ms.xjb.ac.cn